

## INFLUÊNCIA DO ELETRÓLITO NA ELETRODEPOSIÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DE CU SOBRE ELETRODO DE DIAMANTE DOPADO COM BORO

Jorge Tadao Matsushima\*, Laura Camila Diniz Santos, Andrea Boldarini Couto, Maurício Ribeiro Baldan e Neidenêi Gomes Ferreira

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Av. dos Astronautas, 1758, 12227-010 São José dos Campos – SP, Brasil

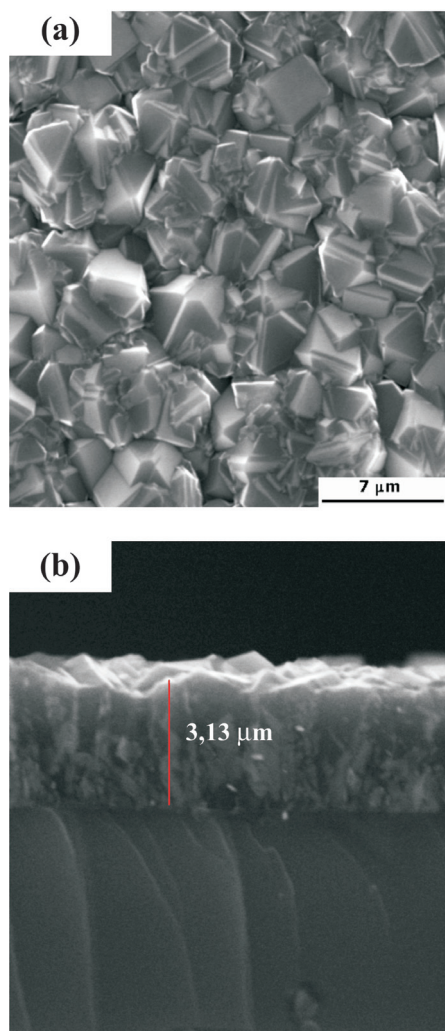


Figura 1S. Imagens MEV do filme de DDB (a) morfologia da superfície; (b) imagem da seção de corte transversal mostrando a espessura do filme

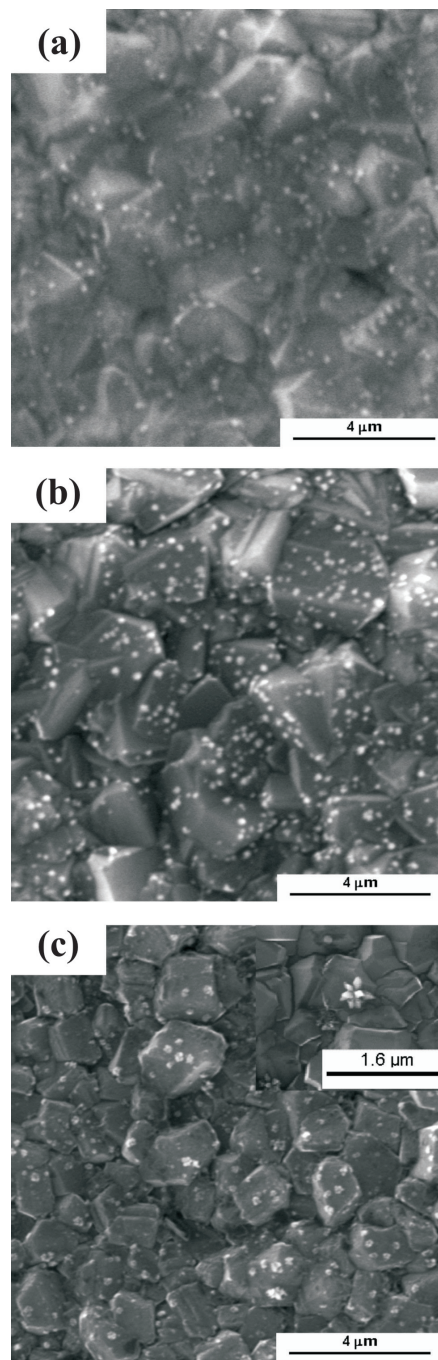


Figura 2S. Imagens MEV dos eletrodepósitos de Cu sobre DDB nas três soluções eletrolíticas. (a)  $0,1 \text{ mol L}^{-1} \text{ HClO}_4 + 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} \text{ CuSO}_4$ ; (b)  $0,1 \text{ mol L}^{-1} \text{ H}_2\text{SO}_4 + 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} \text{ CuSO}_4$  e (c)  $0,5 \text{ mol L}^{-1} \text{ Na}_2\text{SO}_4 + 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} \text{ CuSO}_4$ , respectivamente